

## ボイラの給水及びボイラ水の水質

### 正 誤 票

区分	位置	誤														
本体	表9 ナトリウムの5を超え7.5以下の低濃度水酸化ナトリウム処理の欄	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">区分</td> <td>常用使用圧力</td> <td>MPa</td> <td>5を超え7.5以下</td> </tr> <tr> <td>補給水の種類</td> <td></td> <td>イオン交換水</td> </tr> <tr> <td>処理方式</td> <td></td> <td>低濃度水酸化ナトリウム処理</td> </tr> <tr> <td>ボイラ水</td> <td>ナトリウム</td> <td>Na: mg/L</td> <td>2.8</td> </tr> </table>	区分	常用使用圧力	MPa	5を超え7.5以下	補給水の種類		イオン交換水	処理方式		低濃度水酸化ナトリウム処理	ボイラ水	ナトリウム	Na: mg/L	2.8
		区分		常用使用圧力	MPa	5を超え7.5以下										
				補給水の種類		イオン交換水										
			処理方式		低濃度水酸化ナトリウム処理											
ボイラ水	ナトリウム	Na: mg/L	2.8													
正																
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">区分</td> <td>常用使用圧力</td> <td>MPa</td> <td>5を超え7.5以下</td> </tr> <tr> <td>補給水の種類</td> <td></td> <td>イオン交換水</td> </tr> <tr> <td>処理方式</td> <td></td> <td>低濃度水酸化ナトリウム処理</td> </tr> <tr> <td>ボイラ水</td> <td>ナトリウム</td> <td>Na: mg/L</td> <td>2.8以下</td> </tr> </table>	区分	常用使用圧力	MPa	5を超え7.5以下	補給水の種類		イオン交換水	処理方式		低濃度水酸化ナトリウム処理	ボイラ水	ナトリウム	Na: mg/L	2.8以下		
区分		常用使用圧力	MPa	5を超え7.5以下												
		補給水の種類		イオン交換水												
	処理方式		低濃度水酸化ナトリウム処理													
ボイラ水	ナトリウム	Na: mg/L	2.8以下													
表9(続き) 電気伝導率の7.5を超え10以下の低濃度水酸化ナトリウム処理の欄		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">区分</td> <td>常用使用圧力</td> <td>MPa</td> <td>7.5を超え10以下</td> </tr> <tr> <td>補給水の種類</td> <td></td> <td>イオン交換水</td> </tr> <tr> <td>処理方式</td> <td></td> <td>低濃度水酸化ナトリウム処理</td> </tr> <tr> <td>ボイラ水</td> <td>電気伝導率 (25℃における)</td> <td>mS/m (<math>\mu</math>S/cm)</td> <td>43以下 (30以下)</td> </tr> </table>	区分	常用使用圧力	MPa	7.5を超え10以下	補給水の種類		イオン交換水	処理方式		低濃度水酸化ナトリウム処理	ボイラ水	電気伝導率 (25℃における)	mS/m ( $\mu$ S/cm)	43以下 (30以下)
		区分		常用使用圧力	MPa	7.5を超え10以下										
				補給水の種類		イオン交換水										
			処理方式		低濃度水酸化ナトリウム処理											
ボイラ水	電気伝導率 (25℃における)	mS/m ( $\mu$ S/cm)	43以下 (30以下)													
正																
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">区分</td> <td>常用使用圧力</td> <td>MPa</td> <td>7.5を超え10以下</td> </tr> <tr> <td>補給水の種類</td> <td></td> <td>イオン交換水</td> </tr> <tr> <td>処理方式</td> <td></td> <td>低濃度水酸化ナトリウム処理</td> </tr> <tr> <td>ボイラ水</td> <td>電気伝導率 (25℃における)</td> <td>mS/m (<math>\mu</math>S/cm)</td> <td>3以下 (30以下)</td> </tr> </table>	区分	常用使用圧力	MPa	7.5を超え10以下	補給水の種類		イオン交換水	処理方式		低濃度水酸化ナトリウム処理	ボイラ水	電気伝導率 (25℃における)	mS/m ( $\mu$ S/cm)	3以下 (30以下)		
区分		常用使用圧力	MPa	7.5を超え10以下												
		補給水の種類		イオン交換水												
	処理方式		低濃度水酸化ナトリウム処理													
ボイラ水	電気伝導率 (25℃における)	mS/m ( $\mu$ S/cm)	3以下 (30以下)													
誤																

区分	位置	誤																																																																																																																																											
本体	表 14 pH (25 °C における) の注 a)	常用使用圧力 MPa	7.5 を超え 10 以下	イオン交換水	10 を超え 15 以下	補給水の種類				処理方法	揮発性物質処理	酸素処理	揮発性物質処理	還元剤	あり	なし	なし	酸化還元性	還元形 [AVT(R)]	酸化形 [AVT(O)]	還元形 [AVT(R)]	pH (25 °Cにおける) a)	8.5~10.0	8.5~10.0	8.5~10.0	給水	低酸化形 [AVT(LO)]	酸化形 (OT)	低酸化形 [AVT(LO)]	8.5~10.0	8.5~10.0	8.5~10.0	酸化形 [AVT(O)]	8.5~10.0	8.5~10.0	8.5~10.0	酸化形 (OT)	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0	8.5~10.0	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0
		正																																																																																																																																											
区分		常用使用圧力 MPa	7.5 を超え 10 以下	イオン交換水	10 を超え 15 以下	補給水の種類				処理方法	揮発性物質処理	酸素処理	揮発性物質処理	還元剤	あり	なし	なし	酸化還元性	還元形 [AVT(R)]	酸化形 [AVT(O)]	還元形 [AVT(R)]	pH (25 °Cにおける) a)	8.5~10.0	8.5~10.0	8.5~10.0	給水	低酸化形 [AVT(LO)]	酸化形 (OT)	低酸化形 [AVT(LO)]	8.5~10.0	8.5~10.0	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0	あり	還元形 [AVT(R)]	酸化形 (OT)	還元形 [AVT(R)]	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.5~10.0 <sup>a)</sup>	8.0~10.0	8.5~10.0																																												

区分	位置	誤												
本体 表 14 (続き) pH (25 °C における) の注 a)		区分 給水	常用使用圧力 MPa 補給水の種類 処理方法 還元剤 酸化還元性 pH (25 °Cにおける) a)	15 を超え 20 以下	イオン交換水	20 を超えるもの	揮発性物質処理	酸素処理	還元形 [AVT(R)] 8.5~10.0	あり	酸化形 [AVT(O)] 8.5~10.0	なし	揮発性物質処理	酸素処理
			還元形 [AVT(R)] 8.5~10.0	酸化形 [AVT(O)] 8.5~10.0	低酸化形 [AVT(LO)] 8.5~10.0	酸化形 (OT) 8.0~10.0	還元形 [AVT(R)] 8.5~10.0	酸化形 [AVT(O)] 8.5~10.0	低酸化形 [AVT(LO)] 8.5~10.0	酸化形 [AVT(O)] 8.5~10.0	酸化形 (OT) 8.0~10.0	なし	揮発性物質処理	酸素処理
正														
		区分 給水	常用使用圧力 MPa 補給水の種類 処理方法 還元剤 酸化還元性 pH (25 °Cにおける)	15 を超え 20 以下	イオン交換水	20 を超えるもの	揮発性物質処理	酸素処理	還元形 [AVT(R)] 8.5~10.0	あり	酸化形 [AVT(O)] 8.5~10.0	なし	揮発性物質処理	酸素処理
			還元形 [AVT(R)] 8.5~10.0	酸化形 [AVT(O)] 8.5~10.0	低酸化形 [AVT(LO)] 8.5~10.0	酸化形 (OT) 8.0~10.0	還元形 [AVT(R)] 8.5~10.0	酸化形 [AVT(O)] 8.5~10.0	低酸化形 [AVT(LO)] 8.5~10.0	酸化形 [AVT(O)] 8.5~10.0	酸化形 (OT) 8.0~10.0	なし	揮発性物質処理	酸素処理

区分	位置	誤	正
附属書 A	図 A.20 右側の図の 左上の説明 文	脱酸素剤注入条件時の平均酸素濃度 4.7 µg/L	脱酸素剤注入条件時の平均酸素濃度 4.7 µg/L
		(正)	
		<p>脱酸素剤注入条件時の 平均酸素濃度 4.7 µg/L</p> <p>脱酸素剤無注入条件時の 平均酸素濃度 6.5 µg/L</p> <p>4.7 ppb DO<sub>2</sub> Avg with Oxygen Scavenger</p> <p>6.5 ppb DO<sub>2</sub> Avg without Oxygen Scavenger</p> <p>µg/L DO<sub>2</sub> (Monthly Avg)</p>	
		(  訂正箇所)	
参考文献	附属書 A [34]	誤	正
		M.A.Styrikovich, O.I.Martynova, Z.S.Belova Thermal Engineering, 12, (9), p.115-119.	M.A.Styrikovich, O.I.Martynova, Z.S.Belova (1965): Thermal Engineering, 12, (9), p.115- 119.

平成 28 年 1 月 1 日作成